

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁶
H01L 21/205

(11) 공개번호 특1997-0052086
(43) 공개일자 1997년07월29일

(21) 출원번호	특1995-0067049
(22) 출원일자	1995년12월29일
(71) 출원인	삼성전자 주식회사 김광호
(72) 발명자	경기도 수원시 팔달구 매탄동 416번지 유봉영
	서울특별시 강남구 삼성동 상아아파트 4-1002 배대록
	경기도 용인군 기흥읍 고매리 세원아파트 101-1411 김형섭
	서울특별시 동작구 상도2동 184-65호 대성다세대 302호

심사청구 : 없음

(54) 화학기상 증착 장치의 샤워 헤드(Shower Head)

요약

화학기상 증착장치에서 균일한 가스 분포를 위하여 사용하는 샤워 헤드(Shower Head)가 개시되어 있다.

본 발명은 화학기상 증착장치의 반응 챔버내로 유입되는 가스 분포의 균일도를 높이기 위하여 중앙부로부터 일정간격 이격되어 동심원으로 배치된 다수의 홀(hole)을 구비한 샤워 헤드(Shower Head)에 있어서, 상기 챔버내의 웨이퍼 상에 증착되는 피착물의 두께 및 면 저항의 균일도(uniformity)를 향상시키기 위하여, 상기 샤워 헤드의 중앙부에 배치된 홀(hole)의 갯수를 그 외주면에 위치한 홀의 갯수에 비해 1/2로 감소시킨 것을 특징으로 한다.

대표도

도3

명세서

[발명의 명칭]

화학기상 증착장치의 샤워 헤드(Shower Head)

[도면의 간단한 설명]

제3도는 본 발명에 의한 샤워 헤드의 평면도이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

화학기상 증착장치의 반응 챔버내로 유입되는 가스 분포의 균일도를 높이기 위하여 중앙부로부터 일정간격 이격되어 동심원으로 배치된 다수의 홀(hole)을 구비한 샤워 헤드(Shower Head)에 있어서, 상기 챔버내의 웨이퍼 상에 증착되는 피착물의 두께 및 면 저항의 균일도(uniformity)를 향상시키기 위하여, 상기 샤워 헤드의 중앙부에 배치된 홀(hole)의 갯수를 그 외주면에 위치한 홀의 갯수에 비해 1/2로 감소시킨 것을 특징으로 하는 샤워 헤드.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면3

